

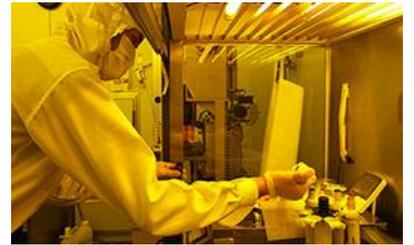
加工 (フォトリソ装置群)

ドラフトチャンバ(有機/無機)

DALTON社製 PAU-1600BEW / BCD-1-1600BEW

仕様

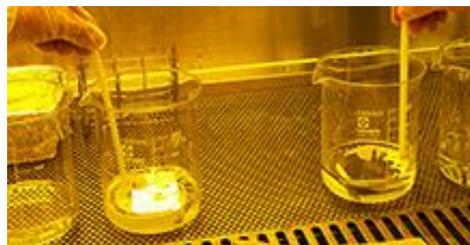
寸法	1600 ^W × 900 ^D × 1860 ^H mm
吹出風速	0.2~0.5m/sec 可変
処理風量	21m ³ /min
集塵要素	メインフィルタ (HEPAフィルタ) プレフィルタ(不織布)
集塵効率	0.3μm粒子にて99.99%以上(DOP)
作業面振動	平均2.0μm以下



排気

半導体プロセスにおいて有毒な気体が発生するときや、揮発性の有害物質を取り扱うときに安全のために用いる局所排気装置です。

半導体の製造工程の洗浄等に用いられる超純水が給水管(循環式PVCクリーンパイプ)から供給(10L/min)されます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム・香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp